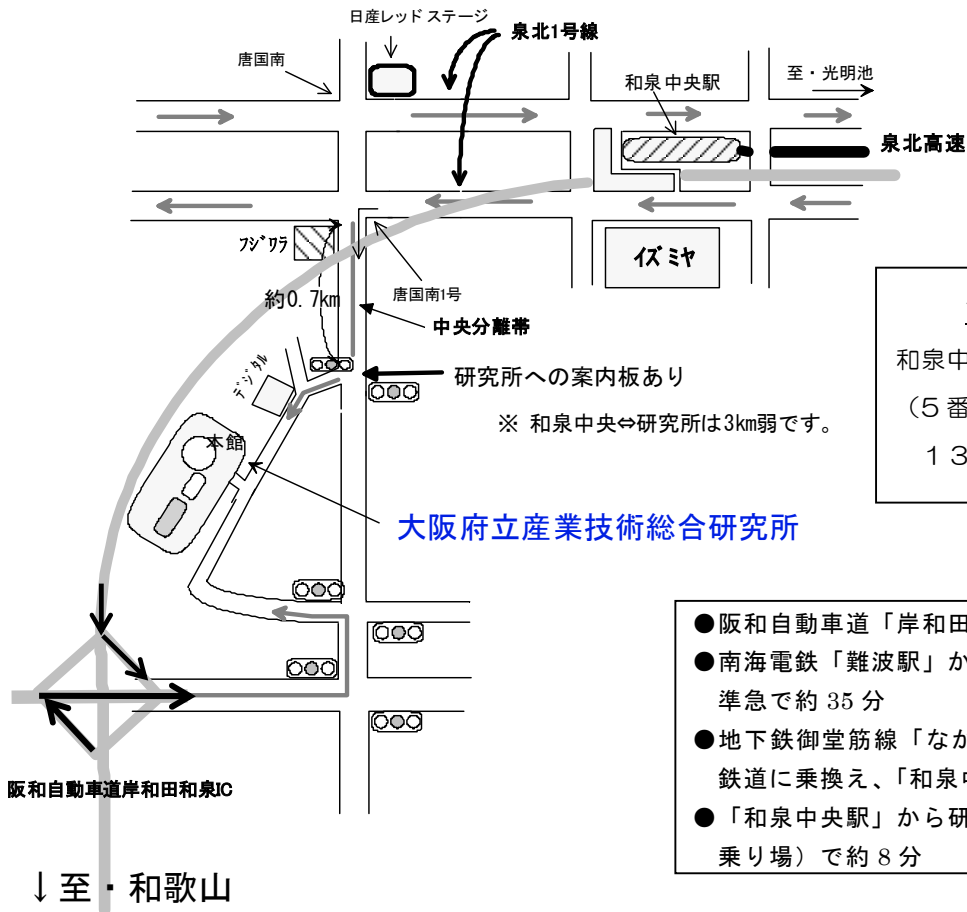


MEMS 技術とフォトリソグラフィの基礎と応用 ～レーザ描画装置の紹介～

研究所では、設置した試験研究機器を用いて中小企業の皆様の新技术・新製品の開発や生産管理・品質管理のお手伝いをしております。これら試験研究機器の関連技術、利用範囲、性能などの特徴をより具体的に皆様方にご理解いただくため、下記内容で講習を行いますのでご案内申し上げます。多数のご参加をお待ちいたしております。

- 日 時 : 平成24年10月26日(金) 13:20 ~ 17:00
- 場 所 : (地独)大阪府立産業技術総合研究所 本館 2階 「第1研修室」
和泉市あゆみ野2-7-1 (裏面図参照)
- 主 催 : (地独)大阪府立産業技術総合研究所、センシング技術応用研究会
- 定 員 : 30名
(受講票は発行いたしません。定員を超えたときは、お断りする方のみご連絡します。)
- 参加費 : 無 料
- 申込先 : センシング技術応用研究会まで FAXまたはメールにてお申込みください。
和泉市あゆみ野2丁目7番1号 (地独)大阪府立産業技術総合研究所内
電話: 0725-51-2534 FAX: 0725-51-2597
メール: sstj@dantai.tri-osaka.jp
- 講習内容
 - ・「MEMS技術とフォトリソグラフィ」13:20~13:50
大阪府立産業技術総合研究所 主任研究員 宇野真由美
携帯電話用マイクロフォンやプロジェクター用DMDなど、MEMS技術で作られたデバイスが身近になってきた。それに伴い、MEMS技術を用いたデバイス開発が活発になっている。ここでは、MEMS技術の中でも最も重要である微細加工技術(フォトリソグラフィ)について解説する。
 - ・「フォトマスク設計の注意点とMEMSセンサの作図例」13:50~14:10
大阪府立産業技術総合研究所 主任研究員 田中恒久
フォトマスク設計初心者を対象にしてフォトマスク設計に必要な基本知識について説明する。本研究所にて開発したMEMS超音波センサのフォトマスク作図例について紹介する。
 - ・「MEMSデバイス向け信号処理システムの開発事例」14:20~14:40
大阪府立産業技術総合研究所 研究員 金岡祐介
MEMSデバイスを回路に搭載するための基本知識について説明し、本研究所で開発した超音波センサなどのMEMSデバイス向け信号処理システムを紹介する。
 - ・「レーザ描画装置の紹介」14:40~15:20
大阪府立産業技術総合研究所 主任研究員 村上修一
He-Cdレーザを搭載したレーザ直接描画装置(ハイデルベルグインストルメンツ社)を(株)日本レーザーより導入した。これによりフォトマスク作製のみならず、フォトレジストを塗布した基板へのマスクレス露光(直接描画)が可能である。講演では、本装置の仕様、利用方法について述べる。
—見学—
- 「(地独)大阪府立産業技術総合研究所 MEMS・薄膜作製関連研究室」15:30~17:00

(地独) 大阪府立産業技術総合研究所
(交通案内)



南海バスの時刻表

和泉中央駅発	研究所発
(5番のりば)	17:06
13:00	17:26

- 阪和自動車道「岸和田和泉IC」から約3分
- 南海電鉄「難波駅」から「和泉中央駅」まで準急で約35分
- 地下鉄御堂筋線「なかもず駅下車」、泉北高速鉄道に乗換え、「和泉中央駅」まで約16分
- 「和泉中央駅」から研究所まで南海バス(5番乗り場)で約8分

技術講習会「MEMS技術とフォトリソグラフィの基礎と応用」申込書-12.10.26-

フォーラム情報源	①産技研HP、②産技研メール配信、③産技研パンフ、④他機関の情報、⑤その他()		
企業名			
所在地	(〒)		
参加者	所属:	役職:	氏名
	所属:	役職:	氏名
連絡先	TEL	FAX	

当研究所の講習会等の案内について、ダイレクトメール等メール配信をご希望の方は、下記にメールアドレスをご記入下さい。

--

※ 上記参加申込書に記載された内容につきましては、本セミナーの参加者の集計及び下記の目的に使用させていただきます。

- ① お客様からの問い合わせへの対応、当研究所利用に関する手続きの案内など、お客様サポート
- ② 当研究所及び関連団体の催事情報提供などの案内